3P109

## 800 nm +400 nm レーザーパルスを組み合わせた

## 動的配向制御の最適化シミュレーション

(東北大院・理) 〇中嶋克宏, 阿部弘哉, 大槻幸義, 河野裕彦

【序】 分子を空間的に整列・配向させることで、化学反応における立体効果の解析や高次高調 波の発生制御など、様々な応用が期待されている。分子整列・配向の制御法として断熱的な方法 と非断熱的な方法がある。前者は静電場、または回転周期より十分長い時間幅のレーザーを照射 し、分極ポテンシャルを誘起することにより電場の存在下で整列・配向を保持する。一方、後者 は回転周期よりも短い時間幅のレーザーパルスを照射し、回転波束を生成し、分子を整列・配向 させる。コヒーレンスが保たれている限り、周期的なタイミングで回転波束の局在化(リバイバル) がおこり、電場が存在しない条件での整列・配向が可能となる。以下では非断熱条件下での配向 制御に絞って議論を行う。

整列制御とは異なり、配向制御を行うには空間的に非対称な相互作用が必要である。しかし、 回転運動の周期はレーザー電場の振動周期に比べて非常に長いため、多くの場合、非対称な相互 作用は時間平均化され消えてしまう。そこで、静電場を利用して対称性を破ることで、配向制御 を行った実験が報告されている[1,2]。しかし、静電場は配向制御以外のダイナミクスに影響を与 える可能性があり応用上望ましくない。

一方、基本波とその第二高調波を組み合わせたレーザーにより、静電場を用いずに配向させる 手法が理論的に提案されている。昨年、800 nm と 400 nm の 2 つの波長領域から成るレーザーパ ルスを用いて、わずかではあるが CO 分子を配向制御した実験が報告された[3]。これを踏まえ本 研究では、3 次の分極相互作用まで取り入れた最適制御シミュレーションを行い、800 nm + 400 nm 波長領域での異核二原子分子(CO)の配向制御機構を数値的に解析する。

【理論】 CO 分子の基底電子状態における振動と回転 (回転周期  $T_{rot}$ = 8.64 ps) について考える。 レーザー電場 E(t)と相互作用する分子のハミルトニアンを次のように表す。

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \boldsymbol{\mu}(r) \cdot \mathbf{E}(t) - \frac{1}{2} \ddot{\boldsymbol{\alpha}}(r) \cdot \mathbf{E}(t) \mathbf{E}(t) - \frac{1}{6} \ddot{\boldsymbol{\beta}}(r) \cdot \mathbf{E}(t) \mathbf{E}(t) \mathbf{E}(t)$$
(1)

ここで、 $\hat{H}_0$ は電場との相互作用を含まないハミルトニアン、rは核間距離、 $\mu(r)$ は永久双極子モ ーメント、 $\ddot{a}(r)$ は分極率、 $\ddot{\beta}(r)$ は超分極率である。電場  $\mathbf{E}(t)$ は直線偏光であるとする。

偏光軸と分子軸のなす角を $\theta$ とし配向度合を次のような  $\cos\theta$  の期待値で評価する。また、整列 度合は  $\cos^2\theta$  の期待値で評価する。

$$F = \left\langle \psi(t_f) \middle| \cos \theta \middle| \psi(t_f) \right\rangle \tag{2}$$

Fの電場  $\mathbf{E}(t)$ に関する変分をとることにより、Fを最大化するような最適電場を求める。ここで、  $t_f$ は制御終時刻、 $|\psi(t)\rangle$ は核の波動関数である。最適制御シミュレーションには、非線形相互作 用を含む場合でも単調収束が保証された対称分割アルゴリズム[4]を用いる。

【結果と考察】 配向制御シミュレーション の結果を示す。温度 0 K、 $t_f = 2T_{rot}$  とした。 図 1(a)は最適制御電場、図 1(b)は  $\cos\theta$ 、  $\cos^2\theta$ の期待値、図1(c)は回転量子数Jが偶数[奇数] である状態の分布の総和の時間変化を示す。 終時刻において F=0.85 の配向度合が得られ た。図2の強度スペクトルから、最適制御電 場には800 nm と400 nm を中心とする成分 が多数含まれることが分かる。これらの振動 数成分は J=0 と J=1 のエネルギー差に相当す る間隔で等間隔に現れており、回転状態を励 起する多数の誘導ラマン過程(図3)に対応し ている。配向制御に必要な奇数の回転量子数 を持つ状態は、電場との3次の相互作用によ り生成する(図 3(b))。また、最適制御電場は 主に2つのパルスで構成されており、配向度 合が回復するタイミングに合わせてパルス を照射することで配向度合を高めている。回 転波束のリバイバルにより、パルス照射後も 周期的に高い配向度合が得られている。







[1]A. Goban et al., Phys. Rev. Lett. 101, 013001 (2008).

[2]O. Ghafur et al., Nat. Phys. 5, 1225 (2009).

からの差を表す

- [3]S. De et al., Phys. Rev. Lett. 103, 153002 (2009).
- [4]Y. Ohtsuki and K. Nakagami, Phys. Rev. A. 77, 033414 (2008).